マ　複数のチャンバー又はステーションを有する洗浄除去装置であって、ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの

ケ・フ　［略］

十七の二・十七の三　［略］

十七の四　半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡であって、次のイからトまでの全てに該当するもの（国際半導体製造装置材料協会が定めたＳＥＭＩ規格に準拠したウエハーの搬送・保管容器（二〇〇ミリメートル以上のフロント・オープニング・ユニファイド・ポッド（ＦＯＵＰ）を含む。）用にウエハー搬入部を設計したものを除く。）

イ　ステージの位置決め精度が三〇ナノメートル未満のもの

ロ　レーザー干渉計によるステージ位置計測が可能なもの

ハ　レーザー干渉計による長さスケール計測に基づく視野の位置校正が可能なもの

ニ　画素数が二〇〇、〇〇〇、〇〇〇を超える画像の収集及び保存が可能なもの

ホ　画像を取得する際の視野の重なりが垂直方向及び水平方向で五パーセント未満のもの

ヘ　画像を結合する際の視野の重なりが五〇ナノメートル未満のもの

ト　加速電圧が二一キロボルトを超えるもの

十八～二十四　［略］

マ　複数のチャンバー又はステーションを有する装置であって、ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの（ウに該当するものを除く。）

ケ・フ　［略］

十七の二・十七の三　［略］

［新設］

十八～二十四　［略］

第七条　輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一　電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品

イ・ロ　［略］

二　［略］

三　デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品（次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。）

イ・ロ　［略］

ハ　デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの（最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。）

ニ～ヌ　［略］

四　電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置、電子組立品若しくは部分品

イ～ハ　［略］

五　［略］

六　量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ　量子計算機であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを三四個以上一〇〇個未満有するもので、ＣＮＯＴエラーが〇・〇〇〇一以下であるもの

第七条　輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一　電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

イ・ロ　［略］

二　［略］

三　デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品（次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。）

イ・ロ　［略］

ハ　デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの（最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。）

ニ～ヌ　［略］

四　電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品

イ～ハ　［略］

五　［略］

［新設］